

【シンガポール】特許審査ガイドラインの一部改正について

2020年3月27日
ジェトロ・バンコク事務所

シンガポール知的財産庁 ("IPOS") は、2020年3月26日、特許審査ガイドライン ("Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS") を一部改正したことを公表した。

今回の改正は、優先権の確認、発明の単一性の欠如及び未開示のディスクレーマーの審査手法に関連するものである。

情報公開日

2020年3月26日

URL 等

https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/resources-library/patents/guidelines-and-useful-information/examination-guidelines-for-patent-applications-at-ipos_2020-mar.pdf

以上

本内容は、日本貿易振興機構が 2020年3月現在、TMI Associates (Thailand) Co., Ltd. 等より入手している情報に基づくものであり、その後の法律改正などによって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは当該機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこの通りであることを保証するものではないことを予めお断りします。